(19) 世界知的所有權機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年10月20日(20.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/098921 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/005527

H01L 21/306, 21/308

(22) 国際出願日:

2005年3月25日(25.03.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特顯2004-109870 2004年4月2日(02.04.2004)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱 住友シリコン株式会社 (SUMITIOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058634 東京都 港区芝浦一丁目2番1号 Tokyo (JP).

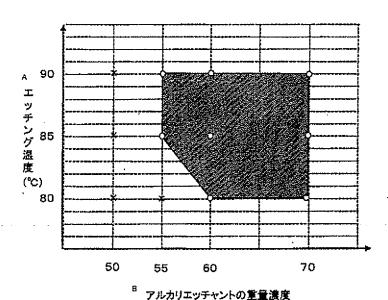
(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 古屋田 栄 (KOY-ATA, Sakae) [JP/JP]; 〒1058634 東京都港区芝浦一丁 目2番1号三菱住友シリコン株式会社内 Tokyo (JP). 高石和成 (TAKAISHI, Kazushige) [JP/JP]; 〒1058634 東京都港区芝浦一丁目2番1号三菱住友シリコン 株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 前田 均 . 外(MAEDA, Hitoshi et al.); 〒 1010051 東京都千代田区神田神保町1丁目1番17号 東京堂神保町第3ビル2階前田・西出国際特許事 務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

/続葉有/

(54) Title: ALKALINE ETCHANT FOR CONTROLLING SURFACE ROUGHNESS OF SEMICONDUCTOR WAFER

(54) 発明の名称: 半導体ウェーハの表面粗さ制御用アルカリエッチャント



(重量%) A_.ETCHING TEMPERATURE (°C) B... WEIGHT CONCENTRATION OF ALKALINE ETCHANT (WEIGHT%)

(57) Abstract: Disclosed is an alkaline etchant for controlling the surface roughness of a semiconductor wafer. The alkaline etchant is composed of an aqueous solution of sodium hydroxide or an aqueous solution of potassium hydroxide, and has a weight concentration from 55 weight% to 70 weight%.

(57) 要約: 半導体ウェーハの表面粗さ制御用アルカリエッチャントであって、水酸化ナトリウム水溶液又は水酸 化カリウム水溶液からなり、重量濃度が55重量%~70重量%である。

WO 2005/098921 A1

NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: - 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。